1**B-**a12

J-PARCニュートリノビームライン用 超伝導電磁石システム(13)

有機材料の低温γ線照射効果

高エネルギー加速器研究機構

〇中本建志 大畠洋克 荻津 透 木村誠宏 植田康博 山本 明

日本原子力研究開発機構 出崎 亮 伊藤久義 森下憲雄

2005年度秋季低温工学・超電導学会 於朱鷺メッセ 2005年11月21日

発表内容

・はじめに

J-PARCニュートリノ振動実験 コンバインドファンクション超伝導磁石 本研究の目的及び低温γ線照射の概要

- ・発生ガス測定
- ・機械特性測定
- ・まとめ

Japan-Proton Accelerator Research Complex Facility



Organic Materials in SCFMs : Evaluated in this study





J-PARCニュートリノビームライン用超伝導磁石に使用される 有機材料の放射線耐性を実験的に評価

照射条件

- ・真空中(ガラスアンプル)、⁶⁰Coγ線を照射
- ・液体窒素温度(77K)または常温 → 照射効果の温度依存性を確認
- ・照射線量:最大15MGy@77K、23MGy@RT(線量率10-20kGy/hr)



<u>・ガス発生量を測定</u>

下記材料+ケーブル絶縁(UpilexRN+エポキシ)

照射前後での機械特性の変化を比較

3点曲げ強度:G-11,PM9640 引き裂き強度:UpilexRN 接着強度:GUG(ガラスシート+Upilex+エポキシ)

Irradiation Facility



原研高崎Co-60γ線照射用 液体窒素クライオスタット









ガラスチューブ(真空)内 に装填された有機材料

試料照射前に、アラニン 線量計を用いて空間線量 率を較正

発表内容

- ・はじめに
- ・発生ガス測定

試料準備及び測定方法:ガスクロマトグラフィ 測定結果:ガス発生量、G値 ヘリウム冷凍機への影響

- ・機械特性測定
- ・まとめ









超伝導磁石システムにおける水素発生量についての検討



発表内容

- ・はじめに
- ・発生ガス測定
- ・機械特性測定

3点曲げ強度試験:GFRP (G-11, PM9640) 引き裂き強度試験:Polyimide film (Upilex-RN) 接着強度試験:GUG

・まとめ























JIS-K7128-1トラウザー法 引き裂き速さ:200 mm/min. ロードセル容量:10 N サンプル:150 mm×50 mm、スリット長 75 mm



UpilexRN125(ポリイミド系)引き裂き強度の吸収線量依存性



※ロール方向の異方性による差異は見られない

接着強度試験の様子











- ・はじめに
- ・機械特性測定
- ・発生ガス測定
- ・まとめ

まとめ

J-PARCニュートリノビームライン超伝導磁石用有機材料に10MGy程度のγ線を照射した際の発生ガス及び機械特性変化を測定 (1)発生ガス測定(ガスクロマトグラフィ):Upilex-RN、G-11、PM9640 (2)3点曲げ強度 :G-11、PM9640 (3)引き裂き強度 :Upilex-RNフィルム (4)接着強度 :GUG



ガス測定:

試料からのガス発生量はポリエチレンと比較して2~3桁少なく、優れた耐放射線性を示した。また発生ガスは、ほぼ100%水素であり、ビームライン全体での発生量は、0.37mol (液体水素の体積として0.01L)と見積もられた。

機械測定:

液体窒素温度77Kでの照射では、明らかな機械特性の劣化は見られなかった。 なお常温照射では、G11に顕著に劣化が見られたが、その他の材料には影響が見られなかっ た。



<u>ビームライン運転10年間で予想される吸収線量が0.3MGyであることを考慮</u> <u>すると、本超伝導磁石の有機材料は十分な耐放射線性を有している。</u>



14 Cells of "Superconducting Combined Function Magnets" (SCFM) 28 CFMs + 2 spares (+ 2 prototypes)
Operated at 40 GeV for the initial several years. >>Then upgraded to 50 GeV.



ポリエチレンとの水素発生挙動の比較



77Kにおけるγ線照射量と水素発生量の関係

●いずれのG(H₂)もポリエチレンより2桁低く、優れた耐放射線性を示す。 ●エポキシ系樹脂よりもフェノール系樹脂の方が水素が発生しやすい。

水素発生のG値

G値:100eVのエネルギー吸収があった時の 反応生成物の数

Sample	G (H ₂)
Upilex-RN Tape	1.13×10 ⁻²
G11	2.18×10-2
PM9640	3.35×10-2
Polyethylene	4.19

超伝導磁石用高分子材料からの低温γ線照射によるガス発生挙動



リこういて、 発生カスのはは1